



多模式可编程调制的旋转横向磁场控制的电弧离子镀装置

文献类型：专利

作者 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 宫骏, 赵彦辉 and 闻立时

发表日期 2009-02-11

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及薄膜制备领域,具体地说是一种利用旋转磁场控制弧斑运动的多模式可编程调制的旋转横向磁场控制的电弧离子镀装置。该电弧离子镀装置设有靶材、旋转磁场装置、电磁线圈、绝缘套、法兰、真空室、基体夹座,真空中室设置基体夹座、靶材,靶材正面与基体夹座相对,靶材背面设有电磁线圈,置于真空室外的旋转磁场发生装置套在围绕于靶材之外的法兰套或者炉体管道上,与法兰套或者炉体管道之间通过绝缘保护。本发明通过多模式可编程调制的旋转横向磁场控制弧斑的运动,可以改善弧斑的放电形式和工作稳定性,提高靶材刻蚀均匀性和靶材利用率,减少靶材大颗粒的发射,用...

公开日期 2009-02-11

语种 中文

专利申请号 CN101363116

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/65950]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 宫骏, 赵彦辉 and 闻立时. 多模式可编程调制的旋转横向磁场控制的电弧离子镀装置. 2009-
GB/T 7714 02-11.

入库方式：OAI收割

来源：金属研究所

浏览	下载	收藏
88	0	0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

